

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



- [Nowe technologie](#)
- [Felieton](#)
- [Tygodnik "Nature"](#)
- [Edukacja](#)
- [Artykuły](#)
- [Przemysł](#)

[Strona główna](#) > [Edukacja](#)

Konkurs „Student - Wynalazca” - II edycja

Zachęcamy do uczestnictwa w II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student - Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej”.

Konkurs adresowany jest do:

- studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
- absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali samodzielnie lub wspólnie wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą, albo w trakcie studiów uzyskali prawo wyłączne na wynalazek lub wzór użytkowy, którego są twórcami lub współtwórcami.

Organizatorzy:

Politechnika Świętokrzyska, Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Patentowego RP, Parlamentu Studentów RP, Forum Uczelni Technicznych

Warunki uczestnictwa:

Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełnią jeden z następujących warunków:

- są studentami I, II lub III stopnia polskiej uczelni i są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego oraz zgłosili swoje rozwiązanie do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów,
- są absolwentami polskiej uczelni i są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego, który zgłosili do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy po zakończeniu studiów,
- są twórcami lub współtwórcami wynalazków lub wzorów użytkowych, na które zostały udzielone prawa wyłączne w okresie trwania studiów.

Nagrody:

- Dla 3-5 Twórców, reprezentujących trzy nagrodzone wynalazki, przewidziano bezpłatny udział w „40th International Exhibition of Inventions of Geneva” w dniach 18-22 kwietnia 2012 r. połączony z prezentacją wynalazku na stoisku wystawienniczym w Genewie oraz podróż i pobyt Twórców.
- Dla Twórców trzech kolejnych wynalazków zostaną przyznane wyróżnienia.

Termin Konkursu:

Formularz zgłoszeniowy online lub w wersji Word lub PDF, należy wypełnić i przesłać do Politechniki Świętokrzyskiej na adres wskazany w Formularzu w terminie do 31 stycznia 2012.

Źródło: <http://www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs/zasady.php>

<https://laboratoria.net/edukacja/12414.html>

Informacje dnia: [Ruszyła IV edycja konkursu Pomosty Przyszłości Kleszcz to tylko pośrednik Jak rower zmienił świat Polacy opracowują aparaturę dla teleskopów europejskiej misji kosmicznej](#) [Badanie: portale społecznościowe nie chronią przed samotnością](#) [Norowirusy - biegunka brudnych rąk](#) [Ruszyła IV edycja konkursu Pomosty Przyszłości Kleszcz to tylko pośrednik Jak rower zmienił świat Polacy opracowują aparaturę dla teleskopów europejskiej misji kosmicznej](#) [Badanie: portale społecznościowe nie chronią przed samotnością](#) [Norowirusy - biegunka brudnych rąk](#) [Ruszyła IV edycja konkursu Pomosty Przyszłości Kleszcz to tylko pośrednik Jak rower zmienił świat Polacy opracowują aparaturę dla teleskopów europejskiej misji kosmicznej](#) [Badanie: portale społecznościowe nie chronią przed samotnością](#) [Norowirusy - biegunka brudnych rąk](#)

Partnerzy